*Załącznik nr 2A do Ogłoszenia*

**Specyfikacja techniczna systemu do czyszczenia preparatów plazmą**

Wymagania obligatoryjne:

1. System czyszczenia preparatów typu downstream z plazmą generowaną poza komorą próbki (ex-situ).
2. System czyszczenia preparatów plazmą ma posiadać co najmniej 3 porty dedykowane do uchwytów TEM.
3. Minimalna wielkość komory powinna wynosić 150 x 150 x 50 mm (długość x szerokość x głębokość), bądź w przypadku komór walcowych Ø 160 x 150 mm (średnica x długość).
4. Źródło plazmy powinno pozwalać na ciągłą regulację mocy w zakresie co najmniej od 10 W do 99 W.
5. Źródło plazmy powinno pozwalać na ciągłą regulację ciśnienia w zakresie co najmniej od 2.0 Tor do 70 mTor.
6. Wymagana możliwość pracy z wymuszonym obiegiem gazu roboczego na poziomie 1x10-8 Tor l/s.
7. System czyszczenia plazmą powinien posiadać pompę do generowania próżni o wydajności co najmniej 60 l/min oraz czujnik próżni.
8. System czyszczenia plazmą powinien być wyposażony w odpowiedni adapter do mikroskopu transmisyjnego JEOL JEM-1230.
9. System do czyszczenia plazmą powinien posiadać graficzny interfejs umożliwiający monitorowanie procesu oraz dający możliwość użycia predefiniowanych, automatycznych cyklów czyszczenia.
10. System do czyszczenia plazmą powinien posiadać graficzny interfejs zaimplementowany na tablecie.
11. System do czyszczenia plazmą powinien być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika, umożliwiający wybór trybów pracy oraz parametrów procesu czyszczenia plazmą, w tym czasu oraz mocy.

Wymagania zalecane:

1. Wymagana możliwość przyszłej integracji głowicy do czyszczenia plazmowego z komorą mikroskopu SEM JEOL JSM-6610 – bez konieczności integracji ww. urządzenia z układem próżniowym mikroskopu. Głowica powinna być montowana do komory mikroskopu z wykorzystaniem adaptera do szybkiego montażu/demontażu.
2. Wymagany kompaktowy system ze zintegrowaną w ramach obudowy pompą próżniową , zapewniający możliwość przemieszczania oraz wyposażony w kółka do łatwego transportu.

………………………………………….

*(podpis i pieczęć upełnomocnionego*

*przedstawiciela Wykonawcy)*